Docket No.: 43890-470

#### **PATENT**

## IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

In re Application of

Kunio KISHIMOTO, et al.

Serial No.:

Group Art Unit:

Filed: December 15, 2000

Examiner:

For:

A METHOD OF MANUFACTURING A CIRCUIT BOARD AND ITS

MANUFACTURING APPARATUS

# CLAIM OF PRIORITY AND TRANSMITTAL OF CERTIFIED PRIORITY DOCUMENT

Commissioner for Patents Washington, DC 20231

Sir:

In accordance with the provisions of 35 U.S.C. 119, Applicants hereby claim the priority of:

Japanese Patent Application No. 11-359251, filed December 17, 1999

A certified copy is submitted herewith.

Respectfully submitted,

MCDERMOTT, WILL & EMERY

Michael E. Fogarty

Registration No. 36,139

600 13<sup>th</sup> Street, N.W. Washington, DC 20005-3096 (202) 756-8000 MEF:klm

**Date: December 15, 2000** Facsimile: (202) 756-8087

43840-470 DECEMBER 15,2000 KISHIMOTO EEG(.

## 日本国特許庁

PATENT OFFICE
JAPANESE GOVERNMENT McDermott, Will & Emery

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日 Date of Application:

1999年12月17日

出 願 番 号 Application Number:

平成11年特許願第359251号

出 願 人 Applicant (s):

松下電器産業株式会社

2000年11月 6日

特許庁長官 Commissioner, Patent Office





【書類名】 特許願

【整理番号】 2166010012

【提出日】 平成11年12月17日

【あて先】 特許庁長官殿

【国際特許分類】 H05K 3/00

【発明者】

【住所又は居所】 大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器産業株式

会社内

【氏名】 岸本 邦雄

【発明者】

【住所又は居所】 大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器産業株式

会社内

【氏名】 西井 利浩

【発明者】

【住所又は居所】 大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器産業株式

会社内

【氏名】 竹中 敏昭

【発明者】

【住所又は居所】 大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器産業株式

会社内

【氏名】 中村 眞治

【発明者】

【住所又は居所】 大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器産業株式

会社内

【氏名】 三浦 章宏

【特許出願人】

【識別番号】 000005821

【氏名又は名称】 松下電器産業株式会社

【代理人】

【識別番号】

100097445

【弁理士】

【氏名又は名称】

岩橋 文雄

【選任した代理人】

【識別番号】

100103355

【弁理士】

【氏名又は名称】 坂口 智康

【選任した代理人】

【識別番号】 100109667

【弁理士】

【氏名又は名称】 内藤 浩樹

【手数料の表示】

011305 【予納台帳番号】

【納付金額】

21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】

明細書 1

【物件名】

図面 1

【物件名】

要約書 1

【包括委任状番号】 9809938

【プルーフの要否】

不要

#### 【書類名】 明細書

【発明の名称】 回路形成基板の製造方法およびその製造装置 【特許請求の範囲】

【請求項1】 基板用基材の片面あるいは両面にフィルム状材料を張り付けてフィルム付き基板材料とする張り付け工程と、前記フィルム付き基板材料にレーザーを照射し、貫通あるいは非貫通穴を形成する穴形成工程と、前記貫通あるいは非貫通穴の内壁に形成された変質部または変質物質の少なくとも一方あるいは両方を、水槽中に超音波振動子を備え洗浄液を充たした水槽中において超音波洗浄することにより選択的に除去する工程と、前記フィルム付き基板材料に付着した異物もしくは水滴を、気体を吹き付けることによって除去するブロー工程からなる回路形成基板の製造方法であって、前記超音波振動子と前記フィルム付き基板材料の間の洗浄液に流れを発生させることを特徴とする回路形成基板の製造方法。

【請求項2】 基板用基材の片面あるいは両面にフィルム状材料を張り付けてフィルム付き基板材料とする張り付け工程と、前記フィルム付き基板材料にレーザーを照射し、貫通あるいは非貫通穴を形成する穴形成工程と、前記貫通あるいは非貫通穴の内壁に形成された変質部または変質物質の少なくとも一方あるいは両方を、水槽中に超音波振動子を備え洗浄液を充たした水槽中において超音波洗浄することにより選択的に除去する工程と、前記フィルム付き基板材料に付着した異物もしくは水滴を、気体を吹き付けることによって除去するブロー工程からなる回路形成基板の製造方法であって、前記超音波振動子と前記フィルム付き基板材料の間に板材を配置することで振動を制御することを特徴とする回路形成基板の製造方法。

【請求項3】 基板用基材の片面あるいは両面にフィルム状材料を張り付けてフィルム付き基板材料とする張り付け工程と、前記フィルム付き基板材料にレーザーを照射し、貫通あるいは非貫通穴を形成する穴形成工程と、前記貫通あるいは非貫通穴の内壁に形成された変質部または変質物質の少なくとも一方あるいは両方を、水槽中に超音波振動子を備え洗浄液を充たした水槽中において超音波洗浄することにより選択的に除去する工程と、前記フィルム付き基板材料に付着し

た異物もしくは水滴を、気体を吹き付けることによって除去するブロー工程からなる回路形成基板の製造方法であって、前記フィルム付き基板材料を板材で挟持もしくは前記基板材料の片側に板材を張り付けた状態で超音波洗浄することを特徴とする回路形成基板の製造方法。

【請求項4】 ポンプと吐出口を備えた吐出装置を用いて洗浄液に流れを発生させることを特徴とする請求項1に記載の回路形成基板の製造方法。

【請求項5】 吐出口がスリット形状である吐出装置を用いた請求項4に記載の回路形成基板の製造方法。

【請求項6】 吐出口がシャワー状である吐出装置を用いた請求項4に記載の 回路形成基板の製造方法。

【請求項7】 1ヵ所以上の吐出口を備えた吐出装置を用いた請求項5または6に記載の回路形成基板の製造方法。

【請求項8】 板材が平板である請求項2に記載の回路形成基板の製造方法。

【請求項9】 板材が波板である請求項2に記載の回路形成基板の製造方法。

【請求項10】 板材は定在波の1/4波長以下の径の穴を1つ以上有したものである請求項8または9に記載の回路形成基板の製造方法。

【請求項11】 板材が金属である請求項2に記載の回路形成基板の製造方法

【請求項12】 板材が複数の薄板で構成されている請求項11に記載の回路 形成基板の製造方法。

【請求項13】 板材の材質が空気層もしくは気泡を内部に持ったものである 請求項3に記載の回路形成基板の製造方法。

【請求項14】 基板材料を板材で挟持する前に前記基板材料を濡らす工程を備えたことを特徴とする請求項3に記載の回路形成基板の製造方法。

【請求項15】 超音波振動子から発せられる音圧が $9.55 \times 10^{10} \mu Pa$ 以上あることを特徴とする請求項2または3に記載の回路形成基板の製造方法。

【請求項16】 板材を設置することにより音圧を4.  $78\times10^{10}\mu$  P a 以上9.  $55\times10^{10}\mu$  P a 以下にすることを特徴とした請求項2または3に記載の回路形成基板の製造方法。

【請求項17】 基板用基材の片面あるいは両面にフィルム状材料を張り付けてフィルム付き基板材料とする張り付け工程と、前記フィルム付き基板材料にレーザーを照射し、貫通あるいは非貫通穴を形成する穴形成工程と、水槽の液体中において洗浄する工程と、前記フィルム付き基板材料に付着した異物もしくは水滴を、気体を吹き付けることによって除去するブロー工程もしくは前記フィルム付き基板材料に付着する異物を回転ブラシ等によって除去する機械的クリーニング工程からなる回路形成基板の製造方法であって、前記洗浄工程、ブロー工程、機械的クリーニング工程のうち少なくともひとつの工程において前記フィルム付き基板材料を加熱手段を用いて加熱することを特徴とする回路形成基板の製造方法。

【請求項18】 洗浄工程あるいはブロー工程あるいは機械的クリーニング工程前にフィルム付き基板材料を加熱する予備加熱手段を備えた請求項1~3記載または17のいずれかに記載の回路形成基板の製造方法。

【請求項19】 洗浄工程で用いる液体を加温することを特徴とする請求項1 ~3または17のいずれかに記載の回路形成基板の製造方法。

【請求項20】 ブロー工程で用いる気体を加温することを特徴とする請求項 1~3または17のいずれかに記載の回路形成基板の製造方法。

【請求項21】 加熱手段による加熱温度を、基板材料もしくはフィルム状材料の耐熱温度あるいは所望する物性変化に達する温度以下で、かつ機械的あるいは物理的ストレスによりフィルムの一部あるいは全体が基板材料より剥離しない温度以上とすることを特徴とする請求項17に記載の回路形成基板の製造方法。

【請求項22】 基板用基材が補強材に熱硬化性樹脂を含浸してBステージ化したプリプレグからなることを特徴とする請求項17に記載の回路形成基板の製造方法。

【請求項23】 補強材がガラス繊維織布あるいは不織布である請求項22に 記載の回路形成基板の製造方法。

【請求項24】 補強材が芳香族ポリアミド繊維織布あるいは不織布である請求項22に記載の回路形成基板の製造方法。

【請求項25】 洗浄する液体が水あるいは精製された純水である請求項1~

3または17のいずれかに記載の回路形成基板の製造方法。

【請求項26】 洗浄する液体が有機溶剤である請求項17に記載の回路形成 基板の製造方法。

【請求項27】 請求項1に記載の回路形成基板の製造方法の後、穴形成工程にて形成された貫通あるいは非貫通の穴に回路形成基板の表面に形成される回路または内部に形成される回路を相互に接続する接続手段を形成する工程を設け、前記接続手段を形成する工程中に基板材料に形成された穴に導電粒子を含有するペーストを充填することを特徴とする回路形成基板の製造方法。

【請求項28】 請求項1に記載の回路形成基板の製造方法の後、穴形成工程にて形成された貫通あるいは非貫通の穴に回路形成基板の表面に形成される回路または内部に形成される回路を相互に接続する接続手段を形成する工程を設け、前記接続手段を形成する工程中にめっきを含むことを特徴とする回路形成基板の製造方法。

【請求項29】 超音波振動子を槽中に備えた水槽と、基板材料と同等以上の面積を有する搬送部材と、前記搬送部材にて基板材料を水槽中の超音波振動子の一定距離上方を通過搬送する手段を備えた回路形成基板の製造装置。

【請求項30】 搬送部材が板材で基板材料を挟持する機構を備えた請求項2 9記載の回路形成基板の製造装置。

【請求項31】 水槽に水流発生装置を備えた請求項29記載の回路形成基板の製造装置。

【請求項32】 水槽中の搬送する手段と超音波振動子の間に水流が発生するような位置に水流発生装置を備えた請求項31記載の回路形成基板の製造装置。

#### 【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】

本発明は回路形成基板の製造方法およびその製造装置に関するものである。

[0002]

【従来の技術】

近年の電子機器の小型化・高密度化に伴って、電子部品を搭載する回路形成基

板も従来の片面基板から両面、多層基板の採用が進み、より多くの回路を基板上 に集積可能な高密度回路形成基板の開発が行われている。

[0003]

高密度回路形成基板においては、従来広く用いられてきたドリル加工による基板への穴(スルーホール)加工に代わって、より高速で微細な加工が可能なレーザー加工法の採用が検討されている(たとえば、Y.Yamanaka et al., ExcimerLa ser Processing In The Micro electronics Fields等)。また、レーザーによる微細な穴加工と導電性ペースト等の接続手段を用いて層間接続を行う回路形成基板も提案されている(特開平6-268345号公報等)。

[0004]

微細な穴を形成し導電ペーストを用いて層間を接続する技術においては、わずかな異物が接続不良の原因となる。本技術においては基板材料に張り付けたフィルムごと穴加工を行いフィルムは導電ペーストを微細穴に充填するためのマスクとして用いられる。従って、フィルムを含めて全てを清浄に保つ必要がある。

[0005]

しかしながらドリル加工、レーザー加工ともに大量の加工屑が発生するので基 板材料に付着することで接続用の穴を塞ぐ事がある。その他、空気中のわずかな 塵埃が微細な穴を塞ぐおそれがある。そのため、導電ペースト充填前に基板材料 の洗浄を行っているが基板材料に張り付けたフィルムは導電ペーストの充填用マ スクとして使用した後には剥がすので非常に弱い強度でしか張り付いていないた め剥がれやすい。

[0006]

図7に示すように基板材料1と接着強度の特に弱い部分で張り付けたPETシート4 a, 4 bが洗浄中に剥がれる場合がある。このような剥がれが貫通穴の周囲に発生すると接続用の導電ペースト31が剥離部33内に滲み、32に示されるような隣接する貫通穴とショートする恐れがある。

[0007]

従って基板材料に大きなストレスを与えずフィルムが剥がれないように洗浄を 行う必要がある。そのため、基板材料の洗浄が十分に行えていない場合も発生し うる。

[0008]

#### 【発明が解決しようとする課題】

しかしながら、基板材料1に穴加工を行う目的は前述したように、基板の表裏 あるいは内層に形成された回路を相互に接続するためであり、穴加工を行った後 にめっき、導電ペーストの充填などの接続手段の形成が行われる。

[0009]

高密度回路形成基板では穴および接続手段のサイズは非常に微小なものである ため、細かな異物でも接続手段の信頼性に重大な影響を与える。そのため、確実 に異物を除去する必要がある。しかしながら現行の方法では大きなストレスを基 板材料に与えるとマスクとなるフィルムが剥がれ、マスクとしての機能を失った りして導電ペーストが基板材料に滲み絶縁信頼性が悪化するなどの問題が発生す る。

#### [0010]

本発明は高品質な微細穴を有した基板材料を実現し、低コストで信頼性の高い 回路形成基板の製造方法およびその製造装置を提供することを目的とする。

#### [0011]

#### 【課題を解決するための手段】

上記課題を解決するために本発明の回路形成基板の製造方法は、基板用基材の 片面あるいは両面にフィルム状材料を張り付けてフィルム付き基板材料とする張 り付け工程を含み、複数の材質より構成される基板材料に貫通あるいは非貫通の 穴加工を行う穴形成工程と、前記穴形成工程にて形成された貫通あるいは非貫通 の穴に回路形成基板の表面に形成される回路または内部に形成される回路を相互 に接続する接続手段を形成する工程を含み、前記穴形成工程がレーザーを前記基 板材料に照射し貫通あるいは非貫通の穴形状を形成する工程と、前記工程により 前記基板材料表面および貫通あるいは非貫通の穴形状内壁に形状された変質部や 前記工程中あるいは工程後に基板材料より遊離した後に前記基板材料に再付着し た粉状ないし塊状の変質物質の少なくとも一方あるいは両方を前記基板材料から 張り付けたフィルムを剥がすことなく前記基板材料より選択的に除去し、所望の

貫通あるいは非貫通の穴形状と清浄な基板材料を得るものである。

[0012]

この方法によれば、高品質の穴加工をレーザー加工の高速性を失うことなく実現し、低コストで信頼性の高い回路形成基板を提供できるものである。

[0013]

#### 【発明の実施の形態】

本発明の請求項1に記載の発明は、基板用基材の片面あるいは両面にフィルム 状材料を張り付けてフィルム付き基板材料とする張り付け工程と、前記フィルム 付き基板材料にレーザーを照射し、貫通あるいは非貫通穴を形成する穴形成工程 と、前記貫通あるいは非貫通穴の内壁に形成された変質部または変質物質の少な くとも一方あるいは両方を、水槽中に超音波振動子を備え洗浄液を充たした水槽 中において超音波洗浄することにより選択的に除去する工程と、前記フィルム付 き基板材料に付着した異物もしくは水滴を、気体を吹き付けることによって除去 するブロー工程からなる回路形成基板の製造方法において、前記超音波振動子と 前記フィルム付き基板材料の間の洗浄液に流れを発生させることを特徴とする回 路形成基板の製造方法というもので、振動の音場を拡散させることでフィルム付 き基板用基材へのダメージを抑制しフィルムを剥がすことなく粉状ないし塊状の 変質物質の少なくとも一方あるいは両方を前記基板材料により選択的に除去し、 所望の貫通あるいは非貫通の穴形状を得、さらに前記基板材料表面を清浄にする 作用を有する。

#### [0014]

本発明の請求項2に記載の発明は、基板用基材の片面あるいは両面にフィルム 状材料を張り付けてフィルム付き基板材料とする張り付け工程と、前記フィルム 付き基板材料にレーザーを照射し、貫通あるいは非貫通穴を形成する穴形成工程 と、前記貫通あるいは非貫通穴の内壁に形成された変質部または変質物質の少な くとも一方あるいは両方を、水槽中に超音波振動子を備え洗浄液を充たした水槽 中において超音波洗浄することにより選択的に除去する工程と、前記フィルム付 き基板材料に付着した異物もしくは水滴を、気体を吹き付けることによって除去 するブロー工程からなる回路形成基板の製造方法において、前記超音波振動子と

前記フィルム付き基板材料の間に板材を配置することで振動を制御することを特徴とする回路形成基板の製造方法というもので、振動のエネルギーを制御して振動の音場を抑制させることでフィルム付き基板用基材からフィルムを剥がすことなく粉状ないし塊状の変質物質の少なくとも一方あるいは両方を前記基板材料により選択的に除去し、所望の貫通あるいは非貫通の穴形状を得、さらに前記基板材料表面を清浄にする作用を有する。

#### [0015]

本発明の請求項3に記載の発明は、基板用基材の片面あるいは両面にフィルム 状材料を張り付けてフィルム付き基板材料とする張り付け工程と、前記フィルム 付き基板材料にレーザーを照射し、貫通あるいは非貫通穴を形成する穴形成工程 と、前記貫通あるいは非貫通穴の内壁に形成された変質部または変質物質の少な くとも一方あるいは両方を、水槽中に超音波振動子を備え洗浄液を充たした水槽 中において超音波洗浄することにより選択的に除去する工程と、前記フィルム付 き基板材料に付着した異物もしくは水滴を、気体を吹き付けることによって除去 するブロー工程からなる回路形成基板の製造方法において、前記フィルム付き基 板材料を板材で挟持もしくは前記基板材料の片側に板材を張り付けた状態で超音 波洗浄することを特徴とした回路形成基板の製造方法というもので、前記基板材 料を板材で挟持して前記基板材料の共振を抑制することで前記基板材料とフィル ム状材料の接着強度の弱い部分から剥がれるのを防止することでフィルム付き基 板用基材からフィルムを剥がすことなく粉状ないし塊状の変質物質の少なくとも 一方あるいは両方を前記基板材料により選択的に除去し、所望の貫通あるいは非 貫通の穴形状を得、さらに前記基板材料表面を清浄にする作用を有する。

#### [0016]

請求項4に記載の発明は、洗浄液に流れを発生させる手段としてポンプを用いる事で水流の流速、量、方向を自由に制御できる作用を有する。

#### [0017]

請求項5に記載の発明は、洗浄液に流れを発生させる吐出装置の吐出口の形状をスリット形状にすることで被洗浄物に衝撃を与えず振動子の有効幅全域に水流を発生させることのできる作用を有する。

[0018]

請求項6に記載の発明は、洗浄液に流れを発生させる吐出装置の吐出口をシャワー状にすることで水圧を容易に上げることができるので振動子が多連になった場合でも1台の吐出装置で全長に水流を与えることのできる作用を有する。

[0019]

請求項7に記載の発明は、流れを発生させる吐出装置を1ヵ所以上に設置する ことで必要な部分に有効に水流を発生させる作用を有する。

[0020]

請求項8に記載の発明は、超音波振動子と基板材料の間に設置する板を平板に することで複数枚重ねることで超音波振動子エネルギーの制御を任意にできる作 用を有する。

[0021]

請求項9に記載の発明は、超音波振動子と基板材料の間に設置する板を波板に することで超音波振動エネルギーを広範囲に拡散することができる作用を有する

[0022]

請求項10に記載の発明は、超音波振動子と基板材料の間に設置する板に定在 波の1/4波長以下の径の穴を1つ以上設けることによりキャビテーションの影響を抑制し衝撃波を有効に得ることができる作用を有する。

[0023]

請求項11に記載の発明は、超音波振動子と基板材料の間に設置する板の材質を金属にすることにより超音波でのエロージョンの影響を少なくし装置の寿命を延ばすことができる作用を有する。

[0024]

請求項12に記載の発明は、超音波振動子と基板材料の間に設置する板を薄板 にして複数枚用いることで音圧の制御が容易に行える作用を有する。

[0025]

請求項13に記載の発明は、基板材料を挟持する板の材質が空気層もしくは気 泡を内部に持った板にする事で前記基板材料が共振する事を抑制する作用を有す る。

#### [0026]

請求項14に記載の発明は、基板材料を板で挟持する前に前記基板材料を濡らすことで前記基板材料と板がリンキングでより強く密着するためさらに共振が抑制され、また、穴に入った洗浄液が穴内のクリーニングをする作用を有する。

#### [0027]

請求項15に記載の発明は、音圧が9.55×10<sup>10</sup> μ P a 以上ある超音波振動子を用いた場合、基板材料と超音波振動子の間に板材を設置し音圧を抑制すると良好な穴形状が得られる条件の適性化がしやすくなる作用を有する。

#### [0028]

請求項16に記載の発明は、板を設置することにより音圧を $4.78 \times 10^{10}$   $\mu$  Pa以上 $9.55 \times 10^{10}$   $\mu$  Pa以下にすることにより基板材料からフィルム 状材料を剥がすことなく良好な穴形状が得られる作用を有する。

#### [0029]

請求項17に記載の発明は、基板用基材の片面あるいは両面にフィルム状材料を張り付けてフィルム付き基板材料とする張り付け工程と、前記フィルム付き基板材料にレーザーを照射し、貫通あるいは非貫通穴を形成する穴形成工程と、水槽の液体中において洗浄する工程と、前記フィルム付き基板材料に付着した異物もしくは水滴を、気体を吹き付けることによって除去するブロー工程もしくは前記フィルム付き基板材料に付着する異物を回転ブラシ等によって除去する機械的クリーニング工程からなる回路形成基板の製造方法において、前記洗浄工程、ブロー工程、機械的クリーニング工程のうち少なくともひとつの工程において前記フィルム付き基板材料を加熱手段を用いて加熱することを特徴とする回路形成基板の製造方法というものであり、前記フィルム付き基板材料を加熱する加熱手段を備えたことで工程中に前記フィルム付き基板材料からのフィルムの剥がれを防止することができる作用を有する。

#### [0030]

請求項18に記載の発明は、洗浄あるいはブロー工程あるいは機械的クリーニング工程の前にフィルム付き基板材料を加熱する予備加熱手段を備えたことによ

って各工程でストレスが加わる前にフィルムと基板材料の接着強度を強化する作 用を有する。

[0031]

請求項19に記載の発明は、洗浄工程で用いる液体を加温することで洗浄中にフィルム付き基板材料からのフィルムの剥がれを防止する作用を有する。

[0032]

請求項20に記載の発明は、ブロー工程で用いる気体を加温することでフィルム付き基板材料の接着強度が強化されるので風圧によるフィルム剥がれを防止する作用を有する。

[0033]

請求項21に記載の発明は、張り付け工程後の基板用基材とフィルム状材料の密着強度が温度に比例する物性を備えており、加熱手段により加熱されたフィルム付き基板材料の温度を、基板材料もしくはフィルム状材料の耐熱温度あるいは所望物性値の変化をまねく限界温度以下で、搬送を含む洗浄工程あるいはブロー工程でフィルム付き基板材料に印加される機械的あるいは物理的ストレスによりフィルムの一部あるいは全体が基板材料より剥離する限界に相当する前記密着強度が得られる加熱温度以上にすることで材料物性を損なうことなく確実にものが作れる作用を有する。

[0034]

請求項22に記載の発明は、基板用基材が補強材に熱硬化性樹脂を含浸してB ステージ化したプリプレグとしたものであり、熱硬化性樹脂が未硬化分を含むも のに対しても水分の影響を最小限にできる作用を有する。

[0035]

請求項23に記載の発明は、補強材がガラス繊維織布あるいは不織布であるものであり、熱硬化性樹脂とガラス繊維の加工レートの差による穴内壁の凹凸を低減できる作用を有する。

[0036]

請求項24に記載の発明は、補強材が芳香族ポリアミド繊維織布あるいは不織布としたことでレーザーによる貫通孔の加工性に優れた芳香族ポリアミド基材を

用いた場合におけるレーザー加工時の熱による溶融した熱硬化型エポキシ樹脂が 粘着性を有する加工屑として貫通孔内に残存しても有効なクリーニングを行うこ とができる回路形成基板の製造方法を提供できるものである。

[0037]

請求項25に記載の発明は、液体が水あるいは精製された純水であるものであり、工程のランニングコストが安価で蒸発した液体の回収装置が不要であるという作用を有する。

[0038]

請求項26に記載の発明は、液体が有機溶剤であるものであり、除去加工後の 基板材料の乾燥が容易にできる作用を有する。

[0039]

請求項27に記載の発明は、接続手段を形成する工程中に基板材料に形成された穴に導電粒子を含有するペーストを充填するものであり、穴内壁が凹凸の少ない形状で加工粉の付着も無いことから、ペーストの穴への充填性が良いという作用を有する。

[0040]

請求項28に記載の発明は、接続手段を形成する工程中にめっきを含むものであり、穴内壁が凹凸の少ない形状で加工粉の付着も無いことからめっきの付きまわり性が良いという作用を有する。

[0041]

請求項29に記載の発明は、水槽中に超音波振動子と基板材料と同面積以上の面を有した板材で基板材料を載せ超音波振動子上に基板材料を搬送できる手段を有することで基板材料の共振を抑制して連続的に洗浄できる作用を有する。

[0042]

請求項30に記載の発明は、基板材料と同面積以上の面を有した板材で基板材料を挟持できる機能を有したことで確実に基板材料の共振を抑制し搬送できる作用を有する。

[0043]

請求項31に記載の発明は、水槽中に超音波振動子と水流を発生させる装置を

有しかつ基板材料を超音波振動子上に搬送する手段を有することで信頼性の高い 回路基板を製造できる作用を有する。

[0044]

請求項32に記載の発明は、超音波振動子と搬送された基板材料間に水流を流すことで基板材料付近に滞留している音場を確実に拡散できる作用を有する。

[0045]

以下、本発明の実施の形態について、図1から図4を用いて説明する。

[0046]

(実施の形態1)

図1 (a) ~ (g) は、本発明の多層回路基板の製造方法の工程断面図である。図1 (a) において、1は、250nm角、厚さ約150μmの絶縁基材としての基板材料であり、例えば芳香族ポリアミド繊維2(以下アラミド繊維と称する)で構成された不織布に熱硬化性エポキシ樹脂3(以下エポキシ樹脂と称する)を含浸させた複合材からなる樹脂含浸基材が用いられる。エポキシ樹脂3は完全に硬化したものではなく、未硬化分を含むいわゆるBステージ状態である。基板材料1は通常プリプレグと呼ばれるものである。

[0047]

4 a, 4 b は、片面にSi系の離型剤を塗布した厚さ約10μmの剥離可能な 樹脂性フィルムであり、例えばポリエチレンテレフタレート(以下PETシート と称する)が用いられる。マスクフィルムとして後工程で用いられた後に剥離し 廃棄されるため非常に弱い強度(ピール強度:1 g / cm幅)でしか接着されてい ない。

[0048]

次に図1(b)に示すようにレーザー9を基板材料1上に照射して貫通穴10を形成する。その際に基板材料1中の熱硬化性エポキシ樹脂およびアラミド繊維は熱により昇華して周囲に飛散する。しかし、穴壁面には昇華しきれなかった熱硬化性エポキシ樹脂あるいはアラミド繊維が硬く脆い変質部11として残る。また、熱硬化性エポキシ樹脂と比較してアラミド繊維は耐熱性が高くレーザーによる加工レートが低いため、昇華しきれずに残りやすく穴内壁は図中に示すような

凹凸形状となる。一方、周囲に飛散した熱硬化性エポキシ樹脂あるいはアラミド 繊維の一部は加工粉12となって基板材料1の表面あるいは貫通穴10の内部に 付着する。

[0049]

次に図1(c)に示すように水温60℃に保たれ、水中ポンプによって水流の発生した超音波水洗槽の超音波振動子13に基板材料1を近づけて振動させる。 超音波振動子13から放射される音波エネルギーによって基板材料1は振動し、 変質部11および加工粉12が基板材料1より脱落、剥離する除去が行われ、図 1(d)に示すような良好に穴形状を持つ基板材料1が得られる。除去加工工程 において、Bステージ状態の熱硬化性エポキシ樹脂を用いているため接着強度に 図2に示す温度特性がありエポキシが硬化しない程度の熱を加えることで接着力 が格段にますため全体のピール強度が向上する。

[0050]

また、水を基板材料1と超音波振動子13の間に流すことにより剥離の原因となるキャビテーションの滞留を無くす効果があるため振動によってのダメージを受けることはなく、硬く脆い変質部11および加工粉12が選択的に除去される。超音波振動子が多連になった場合水流の吐出口を超音波振動子と同数にすることで弱い水流で剥離防止の効果が出る。

[0051]

その他、図1 (c)の工程を次の二つの例の様にしても有効である。

[0052]

図3に示すように超音波振動子13から発振された音圧が $9.55 \times 10^{10}$   $\mu$  Pa以上ある場合と超音波振動子13と基板材料1の間に拡散板17を設置して音圧を $4.78 \times 10^{10}$   $\mu$  Pa以上 $9.55 \times 10^{10}$   $\mu$  Pa以下に制御することで基板材料からのフィルム剥離を防止しかつ硬く脆い変質部11および加工粉12が選択的に除去できる。

[0053]

また、図4に示す様にシャワーなど予め水(洗浄液と同じ成分のもの、図示せず)で濡らした基板材料1を共振抑制板20で挟み超音波洗浄することで基板材

料1とPETシート4を剛体化させることで基板材料1とPETシート4の接着強度の弱い部分の共振を抑制し基板材料1からのPETシート浮きを防止する。 このとき貫通穴10内には予め濡らしたときに洗浄液が充満しているので超音波は到達するため硬く脆い変質部11および加工粉12が選択的に除去される。

[0054]

次に図1(e)に示すように印刷等の手段を用いて導電性ペースト14を貫通 穴10に充填する。貫通穴10は良好な形状であるために導電性ペースト14の 充填は全く妨げられることなく、貫通穴10の内部に完全に充填される。充填後 マスクフィルムであるPETシートを剥離する。

[0055]

次に図1(f)に示すように金属箔15で基板材料1を挟み込み、熱プレス装置(図示せず)を用いて加熱加圧することにより基板材料1は成形されると同時に導電性ペースト14によって金属箔15と金属箔15は電気的に接続される。 次に金属箔15を所望の形状にパターンニングすることにより図1(g)に示すような回路パターン16を有する両面回路形成基板が得られる。

[0056]

なお、本実施の形態では両面回路形成基板について説明したが、工程を複数回繰り返すことにより多層回路形成基板が得られることはいうまでもない。

[0057]

(実施の形態2)

図5に示すように搬送板を兼ねた共振抑制板21をベルトコンベアーに見立て、下側の搬送板上に投入装置22で基板材料1を投入し順次超音波洗浄槽内に流れていくことで自動的に基板材料1の洗浄が実施され洗浄後取り出し装置23で基板材料を取り出す構造にすることで効率的な回路基板製造装置が提供できる。

[0058]

(実施の形態3)

図6は、水中に設置した水中ポンプ18で発生させた水流によってキャビテーションを拡散させた超音波振動子上に基板材料1を搬送できるので基板材料1に キャビテーションが作用せずPETシートの剥離を防止しつつ硬く脆い変質部1 1 および加工粉 1 2 が選択的に除去できるため高品質の回路基板を提供できる装置である。

[0059]

本発明では導電ペースト充填での説明を行ったが、めっきを用いても同様の結果が得られる。

[0060]

#### 【発明の効果】

以上のように本発明の回路形成基板の製造方法および製造装置は、レーザーを 前記基板材料に照射し第1段階の貫通あるいは非貫通の穴形状を形成する工程と 、前記工程により前記基板材料の表面および前記第1段階の貫通あるいは非貫通 の穴形状内壁に形成された変質部や前記工程中あるいは工程後に基板材料より遊 離した後に前記基板材料に再付着した粉状ないし塊状の変質物質の少なくとも一 方あるいは両方を除去する際に前記基板材料を振動させることにより前記基板材 料より選択的に除去する工程で前記基板材料が振動しすぎて前記基板材料に張り 付けたPETシートが剥離しないようにし、所望の貫通あるいは非貫通の穴形状 を得る工程から構成されているため、高品質の穴加工をレーザー加工の高速性を 失うことなく実現し、低コストで信頼性の高い回路形成基板の製造方法を提供で きるものである。

#### 【図面の簡単な説明】

【図1】

本発明の第1の実施の形態における回路形成基板の製造方法の工程断面図

【図2】

同実施の形態における接着強度と水温との関係を示す特性図

【図3】

図1 (c) に代わる回路基板の製造方法の概略工程断面図

【図4】

図1 (c) に代わる回路基板の製造方法の概略工程断面図

【図5】

本発明の第2の実施の形態における回路形成基板の製造装置の概略断面図

#### 【図6】

本発明の第3の実施の形態における回路形成基板の製造装置の概略断面図

#### 【図7】

- (a) 従来の回路形成基板の製造方法における穴加工部平面図
- (b) 同穴加工部断面図

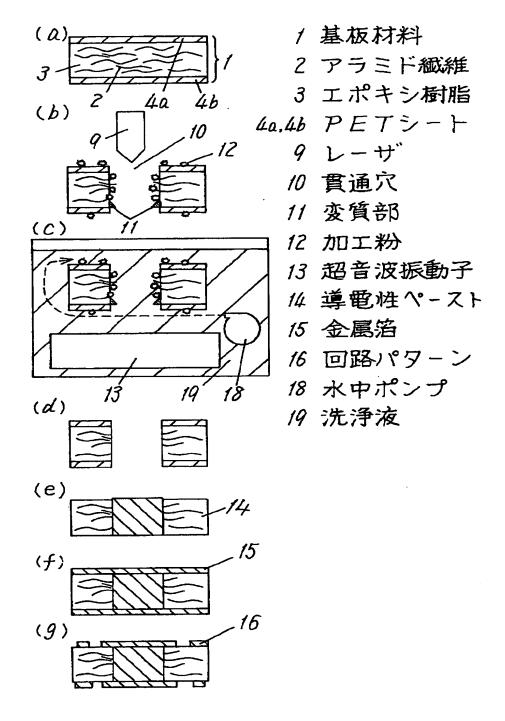
#### 【符号の説明】

- 1 基板材料
- 2 アラミド繊維
- 3 エポキシ樹脂
- 4 a, 4 b PETシート
- 9 レーザー
- 10 貫通穴
- 11 変質部
- 12 加工粉
- 13 超音波振動子
- 14 導電性ペースト
- 15 金属箔
- 16 回路パターン
- 17 拡散板
- 18 水中ポンプ
- 19 洗浄液
- 20 共振抑制板
- 21 搬送板を兼ねた共振抑制板
- 22 投入装置
- 23 取り出し装置

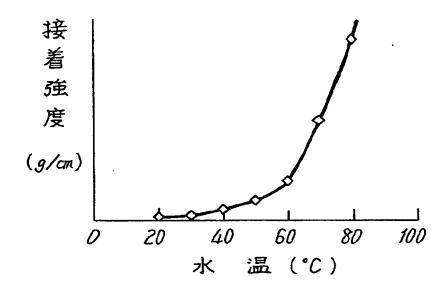
### 【書類名】

図面

【図1】

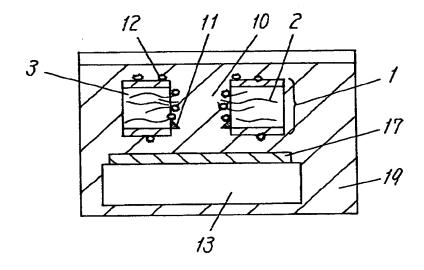


[図2]



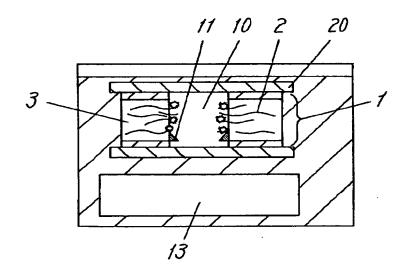
[図3]

- / 基板材料
- 2 アラミド繊維
- 3 エポキシ樹脂
- 40,4b PETシート
  - 10 貫通穴
  - 11 変質部
  - 12 加工粉
  - 13 超音波振動子
  - 17 拡散板
  - 19 洗浄液



【図4】

- 1 基板材料
- 2 アラミド繊維
- 3 エポキシ樹脂
- 4a,4b PETシート
  - 10 貫通穴
  - 11 変質部
  - 12 加工粉
  - 13 超音波振動子
  - 19 洗浄液
  - 20 共振抑制板



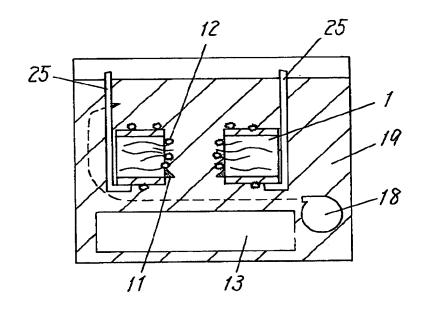
[図5]

/ 基板材料 /3 超音波振動子 /4 洗净液

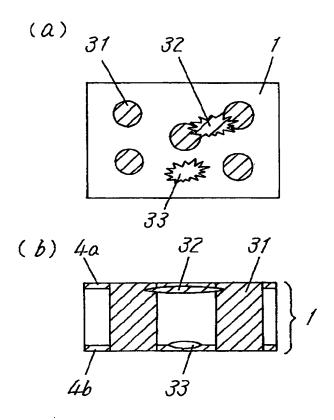
21 被送板を兼ねた共振抑制板22 投入装置23 取り出し装置

[図6]

- 1 基板材料
- 10 貫通穴
- 11 変質部
- 12 加工粉
- 13 超音波振動子
- 18 水中ポンプ
- 19 洗浄液
- 25 搬送装置



## 【図7】



【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 小型電子機器等に用いられる回路形成基板の製造方法において、高 品質の穴加工をレーザー加工の高速性を失うことなく実現し、低コストで信頼性 の高い回路形成基板の製造方法を提供することを目的とする。

【解決手段】 レーザー9を基板材料1上に照射して、貫通穴10を形成する際に穴壁面に付着した硬く脆い変質部11や加工粉12を除去するために超音波振動子13で超音波洗浄する際に基板材料1を過振動させずにPETシート4a,4bを剥がさない様に基板材料1より変質部11および加工粉12の除去加工を行うことにより、良好な穴形状を持つ基板材料1が得られる。

【選択図】 図1

#### 出願人履歴情報

識別番号

[000005821]

1. 変更年月日 1990年 8月28日

[変更理由] 新規登録

住 所 大阪府門真市大字門真1006番地

氏 名 松下電器産業株式会社